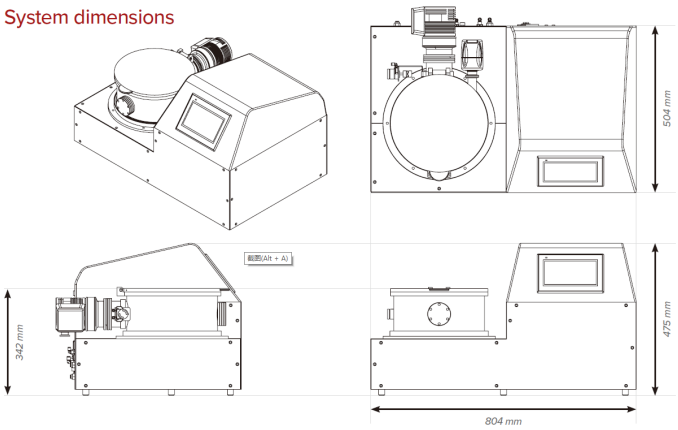
MOORFIELD
NANOTECHNOLOGY

台式精准气氛\压力控制高温退火系统—ANNEAL

ANNEAL精准退火系统

ANNEAL有强大的真空、气氛自动控制系统，从高真空到各种气氛都可以高精度自动控制。ANNEAL可实现Ar，O_2，N_2，H_2等多种气体高精度的流量控制。ANNEAL有多种加热方案满足对不同温度的需求，最高可达1000℃。完备的安全设计方案与独特的尾气稀释方案可以确保即使是在氢气气氛下退火也可以轻松掌控。系统配备的触屏式自动控制系统满足退火程序的设定与存储。



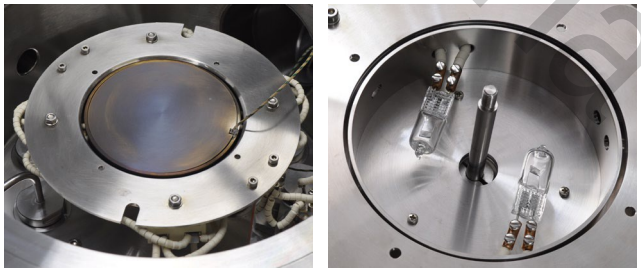
设备尺寸信息

系统简介

台式精准气氛\压力控制高温退火系统—ANNEAL可用于二维材料以及衬底、样品在特定氛围中的高精度热处理，也可用于其他有高精度热处理要求的方向。Moorfield Nanotechnology将样品、衬底等材料的热处理上升到与纳米材料的制备同样的技术高度。通过精准的真空度与气氛控制以及高精度的温度控制使样品的热处理过程变得和样品的制备过程一样高度可控。西班牙光子科学研究所、英国国家物理实验室、曼彻斯特大学等用户对该设备的性能都给与了高度的评价。

主要特点

- 最大可达6英寸直径样品台
- 样品台温度最高1000℃
- 高精度气压控制
- 分子泵/机械泵真空系统
- 本底真空<5×10^{-7}mbar
- 全自动触屏控制系统
- 可编辑存储多个热处理程序
- 完备的安全性设计



ANNEAL的多种加热方式

Quantum Design China

Quantum Design
CHINA